PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-209338

(43) Date of publication of application: 03.08.1999

(51)Int.Cl.

C07C311/48 C07C303/38 C07C303/44 C07F 1/02 C07F 1/06 C07F 3/04

(21)Application number: 10-008141

(71)Applicant:

CENTRAL GLASS CO LTD

(22)Date of filing: 20.01.1998 (72)Inventor:

SAKAGUCHI HIROAKI

SAKAI SHIGENORI

TAKASE HIROSHIGE

(54) PRODUCTION OF SULFONIMIDE

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing a sulfonimide useful as a substance for a Lewis acid catalyst and an ionic conductor in the field of organic syntheses, electrolytes, etc.

SOLUTION: In this method for producing a sulfonimide of general formula I: M[Rf1SO2-N-SO2Rf2]n (in the formula, Rf1 and Rf2 are the same or different and each is a 1-12C straight-chain or branched-chain perfluoroalkyl group, fluoroalkyl group, fluoroalkenyl group or fluoroaryl group; M is a cation; (n) is an integer showing the same valence as that of the cation), one or more sulfonyl chlorides of general formula II: RfSO2CI (in the formula, Rf is the similar group to Rf1 or Ff2) are reacted with anhydrous ammonia and a tertiary amine or a heterocyclic amine of general formula III: (R1)3N (in the formula, R1 is a 1-5C alkyl group).

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.10.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

16.08.2005

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-209338

(43)公開日 平成11年(1999)8月3日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	F I	
C 0 7 C 311/48		C 0 7 C 311/48	
303/38		303/38	
303/44		303/44	
C 0 7 F 1/02		C 0 7 F 1/02	
1/06		1/06	
		審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 6 頁) 最終	頁に続く
(21) 出願番号	特願平10-8141	(71)出顧人 000002200	
		セントラル硝子株式会社	
(22) 出顧日	平成10年(1998) 1 月20日	山口県宇部市大字沖宇部5253番地	
		(72)発明者 阪口 博昭	
		埼玉県川越市今福中台2805番地	ヒントラ
		ル硝子株式会社化学研究所内	
		(72)発明者 坂井 繁則	
		埼玉県川越市今福中台2805番地	ヒントラ
		ル硝子株式会社化学研究所内	
		(72)発明者 高瀬 浩成	
		埼玉県川越市今福中台2805番地	セントラ
		ル硝子株式会社化学研究所内	
	•	(74)代理人 弁理士 西 義之	

(54) 【発明の名称】 スルホンイミドの製造方法

(57) 【要約】

【課題】 有機合成や電解質等の分野において、ルイス 酸触媒やイオン伝導材として有用な物質であるスルホン イミドの製造方法を提供する。

【解決手段】 一般式(I)M〔R[1 SO $_{1}$ -N-SO $_{1}$ R[2]n(式中、R[1 及びR[2 は、同じかまたは異なり、炭素原子数1~12までの直鎖状または分岐状のペルフルオロアルキル基、フルオロアルキル基、フルオロアルキル基、フルオロアルケニル基、またはフルオロアリル基のいずれかで、Mは陽イオンを表し、nは該当する陽イオンの価数と同数の整数を表す)で示されるスルホンイミドの製造法において、一般式(II)R[SO $_{1}$ CI(式中、R[は、一般式(I)のR[1 またはR[2 と同様の基を表す)で示されるスルホニルクロリドの1種または2種と無水アンモニアと、一般式(III)(R 1):N(式中、R 1 は、炭素原子数1~5のアルキル基を表す)で示される第3アミンまたは複素環式アミンと反応させる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(I)

 $M [R['SO_2-N-SO_2R[']] n \qquad (I)$

[式中、R[¹及びR[²は、同じかまたは異なり、炭素原子数1から12までの直鎖状または分岐状のペルフルオロアルキル基、フルオロアルケニル基、またはフルオロアリル基のいずれかで、Mはアルカリ金属イオンまたはアルカリ土類金属イオンを表し、nは該当する金属イオンの価数と同数の整数を表す]で示されるスルホンイミドの製造法における中間体の製造 10方法において、

1

一般式(II)

 $RISO_{2}CI$ (II)

[式中、Rfは、一般式(I)のRf^IまたはRf I と同様の基を表す]で示されるスルホニルクロリドと無水アンモニアと、

一般式(III)

 $(R^1) : N$ (III)

[式中、R⁺は、炭素原子数が1から5のアルキル基を表す]で示される第3アミンまたは複素環式アミンとを 20 反応させることを特徴とするスルホンイミド酸とアミンとの塩の製造方法。

【請求項2】 一般式(1)

M [Ri¹ SO₂ - N - SO₂ Ri²] n (1)

[式中、R f ' 及びR f' は、同じかまたは異なり、炭素原子数1から12までの直鎖状または分岐状のペルフルオロアルキル基、フルオロアルケニル基、またはフルオロアリル基のいずれかで、Mはアルカリ金属イオンまたはアルカリ土類金属イオンを表し、nは該当する金属イオンの価数と同数の整数を表す]で 30示されるスルホンイミドの製造法における中間体の製造方法において、

一般式(II)

 $RfSO_{2}Cl$ (II)

[式中、Rfは、一般式(I)のRf[†]またはRf[†]と同様 の基を表す]で示されるスルホニルクロリドと、

一般式(IV)

 $RfSO_2NH_2$ (IV)

[式中、Rfは、一般式(I)のRf¹またはRf²と同様の基を表す]で示されるスルホンアミドと、

一般式(III)

 (R^1) N (III)

[式中、R¹は、炭素原子数が1から5のアルキル基を表す]で示される第3アミンまたは複素環式アミンとを反応させることを特徴とするスルホンイミド酸とアミンとの塩の製造方法。

【請求項3】 請求項1または請求項2記載の方法で製造されたスルホンイミド酸とアミンとの塩であるスルホンイミド置換アンモニウム塩またはスルホンイミド酸と複素環式アミンとの塩と、アルカリ金属またはアルカリ

土類金属の水酸化物、酸化物、炭酸塩の中から選ばれる 化合物を水溶液中で反応させ、アミンを遊離させた後、 そのアミンを留出させることを特徴とする一般式(I) で示されるスルホンイミドの製造方法。

2

【発明の詳細な説明】

製造することができる。

製造法とはいえない。

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、一般式 (I) M [$R_1^1 SO_2 - N - SO_2 R_1^2$] n で示されるスルホンイミドの製造法に関するものである。

[0002]

【従来の技術および解決すべき問題点】スルホンイミドの化合物は、ルイス酸触媒やイオン伝導材として、有機合成および電解質等の分野において有用な物質である。【0003】前記、一般式のスルホンイミドは、D.D.DESMARTEAUら【INORGANIC CHEMISTRY VOL. 23, No23, 3720~3723 (1984)〕によって提案された合成法で

【0004】この方法は、反応の工程が多く、ヘキサメチルジシラザンのような高価な物質を利用することや収率が50%程度と小さいことから工業的な製造法ではない。また、特表平3-501860号公報では、ペルフルオロアルカンスルホニルフロリドにシラザン金属化合物、またはシラザン誘導体と金属フッ化物とを反応させることにより合成する方法が開示されているが、この方法はN源に高価なシラザン誘導体を使用するため安価な

【0005】本発明の目的とするところは、上記問題点に鑑み、スルホンイミドを工業的で安価に製造する方法を提供するものである。

[0006]

【問題点を解決するための手段】本発明者らは、鋭意検 討の結果、第3アミンまたは複素環式アミンを用いるこ とによりかかる問題点のないスルホンイミドの工業的な 製造法を見いだし、本発明に到達した。

【0007】すなわち、本発明は、一般式(II) RfS O.Cl [式中、Rfは、炭素原子数1から12までの直鎖、分岐状のペルフルオロアルキル基、フルオロアルキル基、フルオロアルケニル基、またはフルオロアリル基 を表す]で示されるスルホニルクロリドと無水アンモニア(NH1)と、一般式(III)(R¹):N [式中、R¹は、炭素原子数が1から5のアルキル基を表す]で示される第3アミンまたはピリジン、ピコリン、ジアザビシクロウンデセンのような複素環式アミンとを反応させる方法、または、一般式(II) RfSO.Clのスルホニルクロリドと一般式(IV) RfSO.NH. [式中、Rfは、炭素子数1から12までの直鎖、分岐状のペルフルオロアルキル基、フルオロアルキル基、フルオロアルキル基、フルオロアルケニル基、またはフルオロアリル基を表す]で示される第 0 ルホンアミドと、一般式(III)(R¹):Nで示される第

10

3アミンまたは複素環式アミンとを反応させる方法によ り、スルホンイミド酸(H [Rí¹SOː-N-SOːR ſ゚]] 「式中、Rſ'及びRſ'は、一般式(I)と同様の 基を表す] とアミンとの塩を製造する方法に関する。ま た本発明は、前記の方法で製造されたスルホンイミド酸 とアミンとの塩であるスルホンイミド置換アンモニウム 塩またはスルホンイミド酸と複素環式アミンとの塩と、 アルカリ金属またはアルカリ土類金属の水酸化物、酸化 物、炭酸塩の中から選ばれる化合物を水溶液で反応させ ることによってアミンを遊離させ、そのアミンを留出さ せることにより一般式(I) M [Rf'SO:-N-SO: Rf'] n [式中、Rf'及びRf'は、同じかまたは異な り、炭素原子数1から12までの直鎖状または分岐状の ペルフルオロアルキル基、フルオロアルキル基、フルオ ロアルケニル基、またはフルオロアリル基のいずれか で、Mは陽イオンを表し、nは該当する陽イオンの価数 と同数の整数を表す]で示されるスルホンイミドの製造 方法を提供するものである。

【0008】一般式(I)で示されるスルホンイミドを合成するにあたって、実施態様の1として、スルホンイ 20ミド置換アンモニウム塩あるいはスルホンイミド酸と複素環式アミンとの塩は、一般式(I)で示されるスルホンイミドのRf'とRf'が同じ化合物を製造する場合には、1種のスルホニルクロリド、またスルホンイミドのRf'とRf'が異なる化合物を製造する場合には、2種のスルホニルクロリドと、無水アンモニアまたは第3アミンあるいは複素環式アミンを不活性溶媒に導入し反応させることによって製造することができる。

【0009】更に、高収率を得るためには、スルホンイミドの R_1^1 と R_1^2 が同じ化合物である場合は、1種の1 30 モルのスルホニルクロリドに対し約1モルのアンモニアと約1モルのアミンを反応させることが必要である。

【0010】反応方法としては、溶媒中で1モルのスルホニルクロリドに対し約1モルのアンモニアを加え、その後、約1モルのアミンをゆっくり加えるか、アミンを溶媒で希釈することにより目的とするイミドのアミン塩が高収率で得られる。

【0011】無水アンモニアを過剰に加えるとスルホンアミドが多く生成し、スルホンイミドの収率が低下する。アミンは過剰に加えて良い。副生物は、NH₄Clおよび塩化水素酸と使用したアミンとの塩が得られる。以下に第3アミンを使用した場合の反応式を示す。

[OO12] $2RfSO_2C1 + 2NH_1 + 2(R')_1N \rightarrow (R')_1NH'(R fSO_2)_2N^{-} + (R^1)_1NH'C1^{-} + NH_4C1$

この反応は、約-20℃から200℃の温度範囲で可能であり、それ以下の温度であれば反応速度は著しく遅くなり、それ以上の温度では使用する化合物、溶媒、生成物の分解が生じる。最適には10℃から90℃の温度範囲が好ましい。

【0013】用いる溶媒は、反応物質に対し不活性なも 50

のであれば特に限定することなく使用できる。例えば、ハロゲン化炭化水素(ジクロロメタン、塩化エチレン、ペルフルオロカーボン等)、炭化水素(ベンゼン、ヘプタン、シクロヘキサン等)、アセタール(ジオキサン等)、エーテル(ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル等)、ニトリル類(アセトニトリル等)がある。【0014】これらの混合物にアルカリ金属またはアルカリ土類金属の水酸化物、酸化物、炭酸塩の中から選ばれた化合物を水溶液中で反応させることによって対応する塩を製造することができる。

【0015】すなわち、アルカリ金属、アルカリ土類金属のカチオンは混合物のカチオンと置換し、アミンを遊離させる。その後、そのアミンおよび水を留出させることにより、そのカチオンと対応するスルホンイミド塩(M [Rf'SO:-N-SO:Rf'] n)と金属塩化物が得られる。その混合物にエーテル、アルコール等を加え、金属塩化物をろ別し、溶媒を留出させることで純度の高い金属スルホンイミド塩が得られる。例えば、LiOHを用いた場合の反応式を示す。

[0 0 1 6] $(R^1)_1 NH^1 (Rf^1 SO_2 NSO_2 Rf^2)^- + (R^1)_2 NH^1 Cl^- + 2LiOH <math>\rightarrow Li^1 (Rf^1 SO_2 NSO_2 Rf^2)^- + 2(R^1)_2 N^2 N + LiCl^- + 2H_2 O^-$

本発明で用いるアルカリ金属またはアルカリ土類金属の水酸化物、酸化物、炭酸塩としては、Li、Na、K、Mg、Ca、Baなどの水酸化物、酸化物、炭酸塩である。

[0017] また実施態様の2として、スルホンイミド酸 (H [R ['SO:-N-SO:R ['])) とアミンとの塩は、一般式 (II) のスルホニルクロリド、一般式 (IV) のスルホンアミド、前記のアミンとを不活性な溶媒に導入し反応させることによって製造できる。

【0018】スルホンアミドは、例えば〔INORGANIC CHEMISTRY VOL. 23, No23, 3720~3723 (1984)〕に記載された合成法で製造することができる。また、RfSOcleとアンモニアとを反応させることで製造することができる。【0019】スルホニルクロリドとスルホンアミドのRfは、同じであっても異なってもよい。高収率を得るためには、1モルのスルホニルクロリドに対し約1モルのスルホンアミド、および約2モルのアミンを反応させることが必要である。

【0020】以下に第3アミンを使用した場合の反応式を示す。

 $Rf^{1}SO_{2}C1 + Rf^{2}SO_{2}NH_{2} + 2(R^{1})_{2}N \rightarrow (R^{1})_{2}NH_{3}$ $(Rf^{1}SO_{2}NSO_{2}Rf^{2})^{-} + (R^{1})_{2}NH^{2}C1^{-}$

この反応は、溶媒中で1モルのスルホニルクロリドに対し約1モルのスルホンアミドを混合し、その後、約2モルのアミンをゆっくり滴下させ反応させることが必要である。

【0021】また、この反応は、約-20℃から200

℃の温度範囲で可能であり、それ以下の温度であれば反 応速度は著しく遅くなり、それ以上の温度では使用する 化合物、溶媒、生成物の分解が生じる。最適には10℃ から90℃の温度範囲が好ましい。使用できる溶媒は、 反応物質に対し不活性なものであれば前記と同様のもの を使用できる。反応終了後、溶媒を留出させ、スルホン イミド置換アンモニウム塩および塩化水素酸とアミンと の塩の混合物が得られる。

【0022】次に得られたこれらの混合物とアルカリ金 属またはアルカリ土類金属の水酸化物、酸化物、炭酸塩 の中から選ばれる化合物とを水溶液中で反応させ、実施 態様の1に記述した同様の手法により、金属と対応する 純度の高いスルホンイミド塩を製造することができる。

【0023】本発明において使用できるアミンは、一般 式 (III) (R¹):N [R¹は、炭素原子数が1から5のア ルキル基を表す]で示される第3アミンまたは複素環式 アミンであるが、特にトリメチルアミン、トリエチルア ミン、トリブチルアミン、ピリジンは反応系から低温度 で容易に留出できるため好ましい。

【0024】これらの製造法で得られるアミンや金属の 20 スルホンイミド塩よりスルホンイミド酸(H [Rf'SO $_{1}-N-SO_{1}R[']$)を合成するには、これらの塩を濃 硫酸のような強酸で酸性化し蒸留することにより得るこ とができる。

【0025】さらにこの酸に適当な金属の水酸化物、酸 化物、炭酸塩、酢酸塩やアンモニア、置換アンモニウム 等を反応させれば、種々のスルホンイミド塩が得られ る。

[0026]

【実施例】以下、本発明を実施例により詳細に説明する 30 が、本発明は、かかる実施例に限定されるものではな 11.

【0027】実施例1

硝子フラスコにアセトニトリルを40m1、トリフルオ ロメタンスルホニルクロリド(CF:SO:C1)を2 2. 1g加え、無水アンモニアを2. 23g導入し、反 応温度20℃で撹拌しながらアセトニトリル100m1 で希釈したトリエチルアミン19.9gを1時間かけ滴 下させた。その後3時間撹伴し、反応させた。

【0028】反応生成物溶液からろ過により塩化アンモ 40 ニウムを除去し、さらにろ液の溶媒を留出させて、ビス トリフルオロメタンスルホンイミドトリエチルアンモニ ウム塩 [(C₁H₅) ₁NH (CF₁SO₂) ₁N] および 塩化トリエチルアンモニウム塩 [(C:H:):NH'C] 〕を得た。

【0029】この混合物と水酸化リチウム(LiOH) を3.50g含む水溶液とを混合し、85℃で反応させ た。反応混合物をろ過により未溶解分を除去し、ろ液の トリエチルアミンおよび水は留出させた。得られた固形 分に、エーテルを加え、未溶解成分を濾別除去しエーテ 50 ムを除去し、さらにろ液の溶媒を蒸留で除去してビスペ

ルを留出させて、ピストリフルオロメタンスルホンイミ ドリチウム [Li (CF: SO:):N] を17. 1g得 た。

【0030】実施例2

硝子フラスコにアセトニトリルを40m1、トリフルオ ロメタンスルホニルクロリド(CF:SO:C1)を2 2. 1g加え、無水アンモニアを2. 23g導入し、反 応温度20℃で撹拌しながらアセトニトリル100m! で希釈したトリエチルアミン19.9gを1時間かけ滴 下させた。その後3時間撹伴し、反応させた。

【0031】反応生成物溶液からろ過により塩化アンモ ニウムを除去し、さらにろ液の溶媒を留出させて、ビス トリフルオロメタンスルホンイミドトリエチルアンモニ ウム塩 [(C, H,), NH (CF, SO,), N] および 塩化トリエチルアンモニウム塩 [(C1H1) NHC1 うを得た。

【0032】この混合物と水酸化カリウム(KOH)を 8. 1 g含む水溶液とを混合し、85℃で反応させた。 反応混合物をろ過して未溶解分を除去し、ろ液のトリエ チルアミンおよび水は留出させた。得られた固形分にエ ーテルを加え、未溶解成分を濾別除去し、エーテルを留 出させて、ビストリフルオロメタンスルホンイミドカリ ウム [K (CF, SO,), N] を18.7g得た。

【0033】実施例3

硝子フラスコにアセトニトリルを70m1、ペルフルオ ロブタンスルホンクロリド(C4F3SO2C1)を4 0.0gを加え、無水アンモニアを2.14g導入し、 反応温度40℃で撹拌しながらアセトニトリル100m 1で希釈したトリエチルアミン20.0gを2時間かけ 滴下させた。その後5時間撹伴し、反応させた。

【0034】反応生成物溶液からろ過により塩化アンモ ニウムを除去し、さらにろ液の溶媒を蒸留で除去してビ スペルフルオロブタンスルホンイミドトリエチルアミン 塩 [(C₁H₅) , NH (C₄F₉SO₂) , N] および塩 化トリエチルアミン塩 [(C₁H₅)₁NH'Cl⁻]を得

【0035】次にこれらの化合物と水酸化リチウム(L iOH) を3.2g含む水溶液とを混合し85℃で反応 させた後、以下実施例1と同様の手法によりピスペルフ ルオロブタンスルホンイミドリチウム [Li (C,F,S O₂)₂N]を31.3g得た。

【0036】実施例4

硝子フラスコにアセトニトリルを70ml、ペルフルオ ロブタンスルホンクロリド(C₄F₉SO₂C1)を4 0.0gを加え、無水アンモニアを2.35g導入し、 反応温度40℃で撹拌しながらアセトニトリル100m 1で希釈したトリエチルアミン20.0gを2時間かけ 滴下させた。その後5時間撹伴し、反応させた。

【0037】反応生成物溶液をろ過して塩化アンモニウ

ルフルオロブタンスルホンイミドトリエチルアミン塩 [(C, H,), NH (C, F, SO,), N] および塩化 トリエチルアミン塩 [(C, H,), NH C l] を得

【0038】次にこれらの化合物と水酸化カリウム(K OH) を7. 74g含む水溶液とを混合し、85℃で反 応させた後、以下実施例1と同様の手法によりビスペル フルオロブタンスルホンイミドカリウム [K (C,F,S O₂)₂N]を36.1g得た。

【0039】実施例5

硝子フラスコにアセトニトリルを50ml、トリフルオ ロメタンスルホンアミド(CF:SO:NH:)を20. 0g、トリフルオロメタンスルホニルクロリド(CF: SO₂C1)を22.6導入した。その後撹拌しながら 20℃の温度でアセトニトリル200mlで希釈したト リエチルアミン40.0gを2時間かけ滴下させた。そ の後3時間撹伴し、反応させた。

【0040】さらに溶媒を蒸留で除去してビストリフル オロメタンスルホンイミドトリエチルアンモニウム塩 [(C, H₅), NH (CF, SO₂), N] および塩化ト 20 リエチルアンモニウム塩 [(C, H,), NH'Cl]を 得た。

【0041】次にこれらの化合物と水酸化リチウム(L iOH) を 6. 80 g 含む水溶液とを混合し、85℃で 反応させた。以下実施例1と同様の手法を用いてピスト リフルオロメタンスルホンイミドリチウム [Li (CF :SO:):N] を36.5g得た。

【0042】実施例6

硝子フラスコにアセトニトリル80ml、ペルフルオロ プタンスルホンアミド (C, F, SO, NH,) を40.0 g、トリフルオロメタンスルホンアミド(CFiSOiC 1) を22.5g加え、その後撹拌しながら40℃の温 度でアセトニトリル200mlで希釈したトリエチルア ミン40.0gを2時間かけ滴下させた。その後、5時 間反応させた。

【0043】さらに溶媒を蒸留で除去してペルフルオロ ブタンスルホントリフルオロメタンスルホンイミドトリ エチルアミン塩 [(C, H,), NH (CF, SO, NSO 2 C4 F9) [] および塩化トリエチルアンモニウム塩 [(C, H,), NH'Cl] を得た。

【0044】次にこれらの化合物と水酸化リチウム(L iOH)を6.74g含む水溶液とを混合した。以下実 施例1と同様の手法を用いてペルフルオロブタンスルホ ントリフルオロメタンスルホンイミドリチウム [Li (CF: SO: NSO: C(F))]を52.3g得た。 【0045】実施例7

硝子フラスコにアセトニトリル80m1、ペルフルオロ プタンスルホンアミド (C, F, SO, NH2) を40g、 トリフルオロメタンスルホニルクロリド(CF:SO:C セトニトリル200mlで希釈したトリエチルアミン4 0.0gを2時間かけ滴下させた。その後、5時間反応 させた。

【0046】溶媒を蒸留で除去してペルフルオロプタン スルホントリフルオロメタンスルホンイミドトリエチル アミン塩 [(C, H,), NH (CF, SO, NSO, C, F 。)] および塩化トリエチルアンモニウム塩 [(C , H,), NH'Cl] を得た。

【0047】次にこれらの化合物と水酸化カリウム(K 10 OH) を15.7g含む水溶液とを混合し、85℃で反 応させた。以下実施例1と同様の手法を用いてペルフル オロブタンスルホントリフルオロメタンスルホンイミド カリウム [K (CF, SO, NSO, C, F,)] を57. 7g得た。

【0048】実施例8

硝子フラスコにアセトニトリル80ml、ペルフルオロ ブタンスルホンクロリド (C, F, SO, C1) を40. 0g、トリフルオロメタンスルホニルアミド(CF:S O₁NH₁)を18.7g加え、撹拌しながら50℃の温 度でアセトニトリル200mlで希釈したトリエチルア ミン38.0gを2時間かけ滴下させた。その後、5時 間反応させた。

【0049】溶媒は蒸留で除去してペルフルオロブタン スルホントリフルオロメタンスルホンイミド塩 [(C₁ H₅),NH (CF,SO,NSO,C,F,)] および塩 化トリエチルアンモニウム塩 [(C₁H₁)₁NH[']C 1] を得た。

【0050】次にこれらの化合物と水酸化カリウム(K OH) を14.7g含む水溶液とを混合し、85℃で反 応させた。以下実施例1と同様の手法を用いてペルフル オロプタンスルホントリフルオロメタンスルホンイミド カリウム [K (CF, SO, NSO, C, F,)] を51. 3 g 得た。

【0051】実施例9

40

硝子フラスコにアセトニトリル80m1、ペルフルオロ オクタンスルホンアミド (C:Fir SO:NH:)を4 0. 0g、トリフルオロメタンスルホニルクロリド(C F₁SO₂C1) を13.5g加え、撹拌しながら50℃ の温度でアセトニトリル100mlで希釈したピリジン 18.0gを3時間かけ滴下させた。その後、50℃で 7時間反応させた。

【0052】その後溶媒を蒸留で除去してペルフルオロ オクタンスルホントリフルオロメタンスルホンイミドピ リジウム塩「C₅ H₅ NH'(CF₅ SO₅ NSO₅ C ,F ɪ)] および塩化ピリジウム塩 [C i H i N H C 1 を得た。

【0053】次にこれらの化合物と水酸化リチウム(L iOH)を4.1g含む水溶液とを混合した。その後 反応混合物を実施例1と同様の手法を用いて、ペルフル 1) を22.5g加え、撹拌しながら40℃の温度でア 50 オロオクタンスルホントリフルオロメタンスルホンイミ

ドリチウム [Li (CF: SO: NSO: C: Fir)] を4 3. 4 g 得た。

【0054】実施例10

硝子フラスコにアセトニトリル80m1、ペンタフルオ ロベンゼンスルホンアミド(C, F, SO, NH,)を4 0. 0g、トリフルオロメタンスルホニルクロリド(C F₁SO₂C1)を27.3g加え、撹拌しながら40℃ の温度でピリジン38.4gをアセトニトリル200m 1で希釈した液を2時間かけ滴下させた。その後、50 ℃で7時間反応させた。

【0055】その後溶媒を蒸留で除去して、ペンタフル オロベンゼンスルホントリフルオロメタンスルホンイミ ドピリジウム塩 [C; H; NH (CF; SO; NSO; C; F₅) ¹] および塩化ピリジウム塩 [C₅H₅NH C l ¹] を得た。

【0056】次にこれらの化合物と水酸化リチウム(L iOH)を8.1g含む水溶液とを混合した。その後反 応混合物を実施例1と同様の手法を用いて、ペンタフル オロベンゼンスルホントリフルオロメタンスルホンイミ ドリチウム [Li (CF: SO: NSO: C: F:)] を5 1.1 g得た。

【0057】実施例11

* 硝子フラスコにアセトニトリルを50m1、トリフルオ ロメタンスルホンアミド(CF, SO, NH,)を20. 0g、トリフルオロメタンスルホニルクロリド(CF: SO₁C1) を22.6 g導入した。その後撹拌しなが ら20℃の温度でアセトニトリル200mlで希釈した トリエチルアミンを40.0gを2時間かけ滴下させ た。その後3時間撹伴した。さらに溶媒を蒸留で除去し てピストリフルオロメタンスルホンイミドトリエチルア ンモニウム塩 [(C, H,), NH (CF, SO,), N] 10 および塩化トリエチルアンモニウム塩「(C, H,), N H'Cl] を得た。

【0058】次にこれらの化合物と水酸化カルシウム (Ca (OH) 1) を10. 4g含む水溶液とを混合 し、85℃で反応させた。以下実施例1と同様の手法を 用いてピストリフルオロメタンスルホンイミドカルシウ ム [Ca((CF, SO,), N),]を34.2g得た。 【0059】以上の実施例1~11で得られたアミン塩 あるいはピリジウム塩は核磁気共鳴により同定した。 [0060]

【発明の効果】本発明の方法により、有機合成や電解質 として有用なスルホンイミド化合物を容易に高収率で製 造することが可能となる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

C 0 7 F 3/04 FI

20

C 0 7 F 3/04